

未踏デバイス試作共用ライン (COLOMODE) 装置一覧

2024年4月1日現在

No.	装置番号	施設等名称	備考	
1	COL001	ゲート金属スパッタ成膜装置 (スパッタ装置A室)	4F クリーンルーム	成膜装置
2	COL002	配線金属スパッタ成膜装置 (スパッタ装置B室)	4F クリーンルーム	成膜装置
3	COL003	プラズマポリシリコン成膜装置	4F クリーンルーム	成膜装置
4	COL004	プラズマ絶縁膜成膜装置	4F クリーンルーム	成膜装置
5	COL005	半導体酸化膜エッチング装置	4F クリーンルーム	エッチング装置
6	COL006	金属エッチング装置	4F クリーンルーム	エッチング装置
7	COL007	アッシング装置 (MAS 装置 A 室)	4F クリーンルーム	エッチング装置
8	COL008	等方性エッチング装置 (MAS 装置 B 室)	4F クリーンルーム	エッチング装置
9	COL009	原子層堆積装置(ALD)	4F クリーンルーム	成膜装置
10	COL010	自動洗浄装置	4F クリーンルーム	ウェット処理装置
11	COL011	酸化炉 (横型三段炉上段)	4F クリーンルーム	熱処理装置
12	COL012	加熱炉 (横型三段炉中段)	4F クリーンルーム	熱処理装置
13	COL013	水素シンター炉 (横型三段炉下段)	4F クリーンルーム	熱処理装置
14	COL014	熱ポリシリコン成膜装置	4F クリーンルーム	成膜装置
No.	装置番号	施設等名称	備考	No.
15	COL015	熱窒化膜成膜装置	4F クリーンルーム	成膜装置
16	COL016	急速加熱装置 (RTA)	4F クリーンルーム	熱処理装置
17	COL017	電子線描画装置	4F クリーンルーム	リソグラフィ装置
18	COL018	レジスト塗布・現像装置	4F クリーンルーム	ウェット処理装置
19	COL019	マスクレス露光装置	4F クリーンルーム	リソグラフィ装置
20	COL020	エピタキシャル成長装置	3F クリーンブース	結晶成長装置
21	COL021	フラッシュランプアニール装置 (FLA)	3F クリーンブース	熱処理装置